

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年11月9日(2006.11.9)

【公開番号】特開2001-239143(P2001-239143A)

【公開日】平成13年9月4日(2001.9.4)

【出願番号】特願2000-52666(P2000-52666)

【国際特許分類】

B 0 1 J	3/00	(2006.01)
C 2 3 C	14/00	(2006.01)
F 1 6 K	1/18	(2006.01)
F 1 6 K	51/02	(2006.01)
H 0 1 L	21/205	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	3/00	J
C 2 3 C	14/00	B
F 1 6 K	1/18	B
F 1 6 K	51/02	A
H 0 1 L	21/205	

【手続補正書】

【提出日】平成18年9月21日(2006.9.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも第一及び第二の室を有し、前記第一の室が前記第二の室を通して排気される真空装置において、前記第一の室と第二の室とが、設置角度可変の一ないし複数の板によって仕切られていることを特徴とする真空装置。

【請求項2】前記角度可変の一ないし複数の板によって排気速度調整機能をもたらすことを特徴とする請求項1記載の真空装置。

【請求項3】前記角度可変の一ないし複数の板の角度を制御する手段を有することを特徴とする請求項1記載の真空装置。

【請求項4】前記真空装置が、真空蒸着装置であることを特徴とする請求項1記載の真空装置。

【請求項5】前記真空装置が、イオンプレーティング装置であることを特徴とする請求項1記載の真空装置。

【請求項6】前記真空装置が、スパッタリング装置であることを特徴とする請求項1記載の真空装置。

【請求項7】前記角度可変の一ないし複数の板によって蒸着物質、あるいはスパッタ物質の回り込みを防止することを特徴とする請求項4、5、6記載の真空装置。